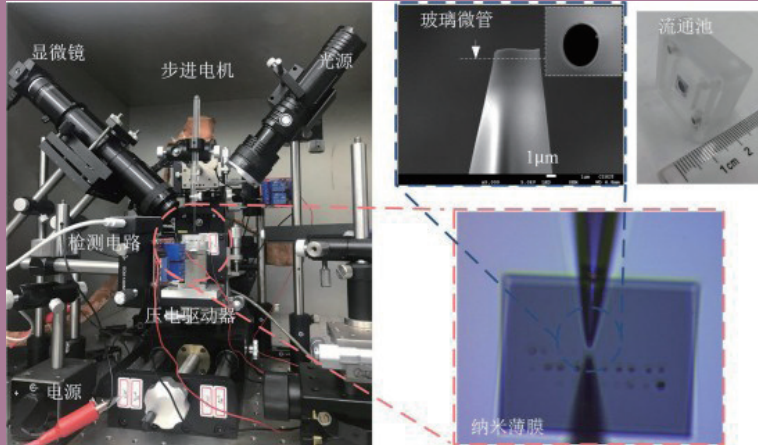


固态纳米孔制备仪

Solid-state Nanopore Dielectric Breakdown Apparatus

CASIA-OPT-01



主要技术与性能指标

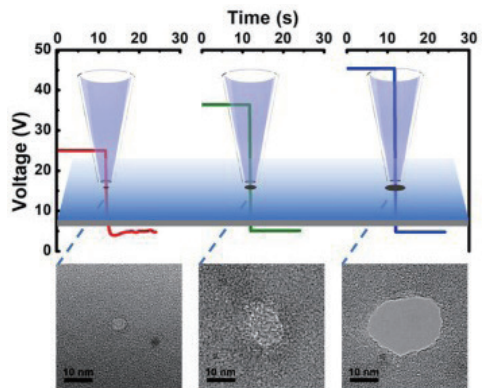
- 纳米孔孔径：0.5—200 nm
- 单个纳米孔成孔时间：< 1 s
- 纳米孔位置精度：> 100 nm
- 可制备纳米孔阵列
- 加工薄膜厚度：0.35—200 nm
- 加工行程：25 cm×25 cm

主要应用

氮化硅、石墨烯、二氧化硅、二硫化钼、二硫化钨、PMMA 固态纳米孔 / 阵列原位精确快速制备

代表性应用成果

- 制备 1—60 nm 的氮化硅阵列纳米孔，测试 RNA 分子（如图）；
- 制备 0.5—60 nm 的石墨烯纳米孔；
- 制备 2—200 nm 的 PMMA 纳米孔



主要用户单位	中国科学院重庆绿色智能技术研究院、重庆中科德馨生物科技有限公司、美国 Universal Sequencing Technology 公司
研制单位	中国科学院重庆绿色智能技术研究院
联系方式	方绍熙 023-65935475 18290478679 fangshaoyi@cigit.ac.cn